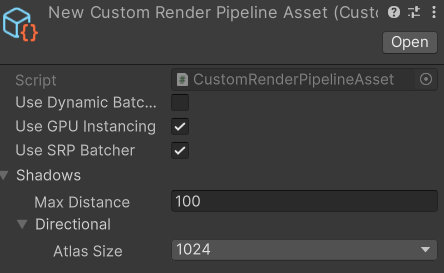
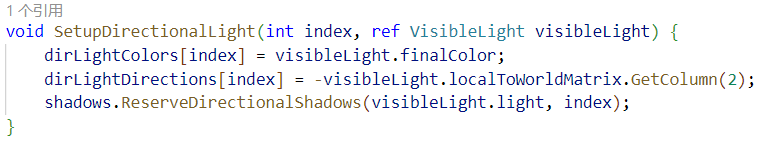
本部分包含方向光源的阴影实现，并支持了级联阴影方案。

使用RP Asset配置阴影参数，并在构造时传给RP。



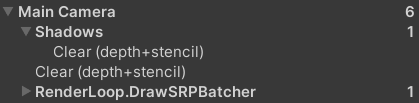
对应的参数进一步传给Renderer，先在剔除的时候使用maxShadowDistance，其次在管理光源的结构体中，创建管理阴影的结构体实例(Shadows)。

然后在设置平行光的时候，存储可以投射阴影的光源index。



接着，在设置好光源后，调用Shadows类的Render方法，在方法中，先申请阴影贴图，再将该帖图设置为RenderTarget。

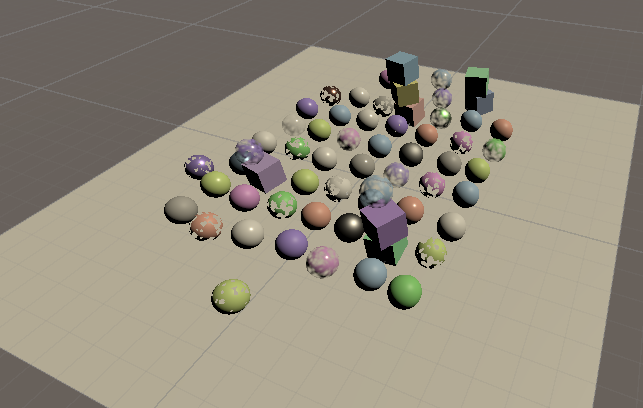
这时，我们需要调整Pipeline的顺序，把设置光照的部分与设置相机的部分对调，目的是在绘制正常的场景前，就完成阴影贴图的绘制工作。



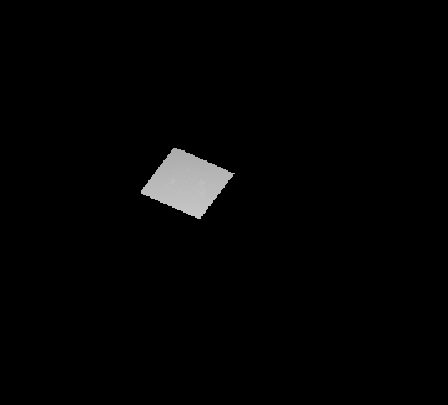
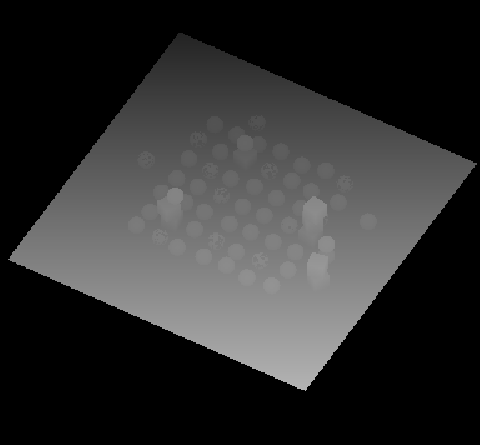
配置好shadowSettings（具体见代码），就可以通过Context调用DrawShadows了。

但是，该方法只会对包含ShadowCaster这个Pass的材质进行绘制，所以要为着色器添加对应Pass。并且，该Pass只会写入深度。对于Lit材质对应的ShadowCaster，只需要拷贝它着色部分的代码，并删除绘制颜色的部分即可。

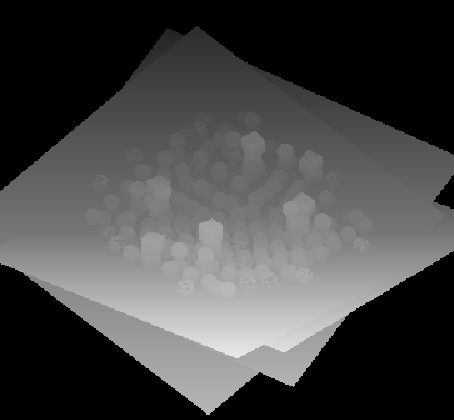
测试场景，一个方向光：



改变最大阴影距离，查看阴影贴图绘制结果：

但是当使用多个光源时，它们的阴影贴图会叠加到一起：



修改Viewport的设置，让它们不会重合：

